

參考文獻

1. M.C.Hutley,'Diffraction Grating',1982,Academic Press,London
2. Jian-Jun He,Boris Lamontagne,Andr'e Del'age,Lynden Erickson,Michael Davies,and Emil S. Koteles,1998,J. Light Wave Technology, 16(4), p.631-638
3. 程曜,'X光深刻術簡介',科儀新知,18(3), December 1996.
4. W. Ehrfeld, H. Lehr; Radiat. Phys. Chem. Vol. 45, No. 3, pp. 349-365, 1995.
5. R. K. Kupka,F. Bouamrane,C. Cremers,and S. Megtert,Applied Surface Science,164,97(2000).
6. 許博淵,洪瑞堂,黃泰源,劉昆沛,周長彬,SU-8光阻在高解析度X光微加工技術的新應用。
7. 張曉航,'DWDM 高密度波長多工光纖通信系統之研究',國防大學中正理工學院應用物理所, June, 2002.
8. 林暉雄,林俊廷,林于仁,傅同龍,林郁欣,陸懋宏,'凹面型微光柵分光元件之設計與應用',科儀新知,24(3),December 2002.
9. 林暉雄,'國內首度成功開發凹面型微光柵',精儀中心簡訊 54, December 2002.
10. 林俊廷,'凹面柱狀型微光柵的設計與製作',交通大學電子物理研究所碩士論文,六月,1992.
11. E.w.Becker,W.Ehrfeld.D.Munchmeyer,H.Betz,A.Heuberger,S.Pongeatz,W.Glashauser,H.J.Michel,andV.R.Siemens,Naturwissenschaften.69,5

20,1982

12. 許博淵, X-ray Micromachining上課講義, 2 月, 2002.
13. Marc Madou, Fundamentals of Microfabrication, CRC, p.275-276, 1997
14. 楊啟榮, 強玲英, 黃奇聲, “微系統 LIGA 製程之精密電鑄技術,” 科儀 新知, 2(1), pp.4-16, 2000.
15. W. Ehrfeld, P. Bley, F. Gotz, J. Mohr, D. Munchmeyer, W. Schelb, J. Vac. Sci. Technol. B, Vol. 6, No. 1, 178-182, 1988.
16. 財團法人國家同步輻射研究中心網頁簡介。
17. M. Madou; Fundamentals of Microfabrication, pp. 281, New York, CRC Press LLC, 1997
18. J. Mohr, W. Ehrfeld, D. Munchmeyer; J. Vac. Sci. Technol. B6(6), pp. 2264-2267, 1988.
19. J. Mohr, W. Ehrfeld, D. Munchmeyer, A. Stutz; Makromol. Chem. Macromol. Symp. 24, pp. 231-251, 1989.
20. D. Munchmeyer, J. Langen; Rev. Sci. Instrum. 63(1), pp. 713-721, 1992.
21. W. Ehrfeld, P. Bley, F. Gotz, J. Mohr, D. Munchmeyer, W. Schelb; J. Vac. Sci. Technol. B6(1), pp. 178-182.
22. T. Numazawa, Y. Hirata, H. Takada; Microsystem Technologies 2, pp. 46-49, 1996.
23. O Wollersheim, et. al.; J. Micromech. Microeng. 4, pp. 84-93, 1994.
24. V. White, R. Ghodssi, C. Herdey, D. D. Denton, L. McCaughen; Appl. Phys. Lett. 66(16), pp. 2072-2073, 1995.

25. R. Schenk, O. Halle, K. Mullen, W. Ehrfeld, M. Schmidt, Microelectronic Engineering 35, pp. 105-108, 1997.
26. H.Lorenz, et al., "Mechanical characterization of a new high-aspect-ratio near UV-photoresist", Microelectronic Engineering 41/42 (1998) pp.371-374.
27. 楊啟榮，"SU-8 厚膜光阻於微系統 UV-LIGA 製程的應用"，科儀新知，21(5)，4(1999).
28. Hyun-Kee Chang, Yong-Kweon Kim, "UV-LIGA process for high aspect ratio structure using stress barrier and C-shaped etch hole", Sensors and Actuators 84 (2000) pp.342-350.
29. <http://www.microchem.com>
30. 梁茂璋，'基於X光光刻製造技術之凹面光柵分光晶片之設計與檢測'，元智大學電機所光電組碩士論文，六月，2004.